



2019年8月23日

各相关方

上市公司名称 株式会社光驰
代表人 董事长社长兼执行董事 林 为平
(股票代码: 6235 东证一部)
咨询责任人 董事兼专务执行董事管理部长 高桥 俊典
(TEL+81-3-6635-9487)

关于 ALD 设备开发完成的通知

本公司对光学薄膜进行进一步改良, 现已完成使用 ALD (原子层沉积法) 的新型设备的开发, 特此通知。我们融合了集团公司 Afly solution Oy 公司 (芬兰) 的 ALD 技术和本公司的等离子体技术, 进行了为用于光学薄膜而做了优化的等离子体原子层沉积设备 (A800P) 的新开发, 现已顺利完成。

该设备的特点是可在镜片局部表面或 3D 结构物体等复杂的表面以低温形成均一、超薄的覆膜。此外, 使用等离子体原子层沉积设备, 不仅可解决一直以来作为课题存在的大量成膜的问题, 而且通过优化原料供应及等离子体照射, 还可缩短平均每次的成膜时间, 有助于客户提高生产效率。

本设备有望用于智能手机等高性能相机镜头的防反射膜或锂离子电池和 Micro LED 的保护膜等的成膜。

今后, 本公司将继续将成膜技术应用到新型设备中, 不断努力开拓新的市场。

参考:

ALD (Atomic Layer Deposition: 原子层沉积法) 是芬兰开发的利用真空进行成膜的技术, 是指利用原子的自调特性的特点, 分层逐步让原子沉积的成膜方法。